

ホロンの研究開発と新事業

NEDO助成事業 (1003) シームレスモールドステッパー

◆兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 松井研究室

松井真二 教授、岡田真 研究員

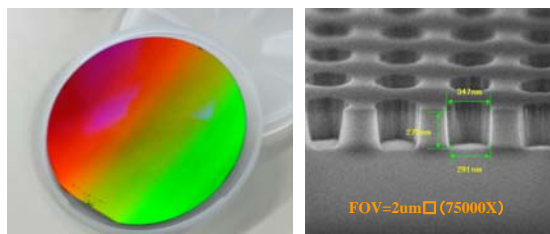
電子線レジストのエッチング特性評価

ZEP-520A (Zeon)

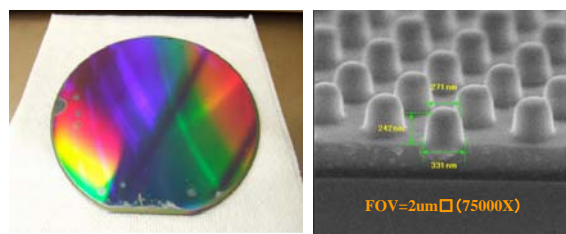
EB描画後、 CHF_3 反応性イオンエッチングにより、エッチングを行った。

CHF_3 プラズマに対するZEP-520Aのエッチングレートは21nm/minであり、ナノインプリント用モールドを製作するための十分なエッチング耐性を有している。

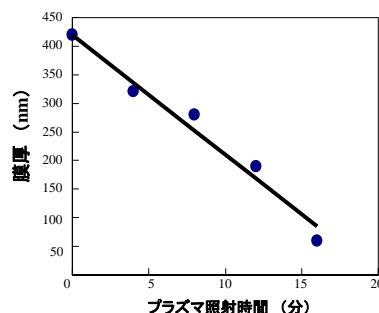
ナノインプリント用モールド製作と転写実験評価



4 inch ナノインプリント用モールドの製作品



ナノインプリント装置による転写基板 (4 inch Wafer)

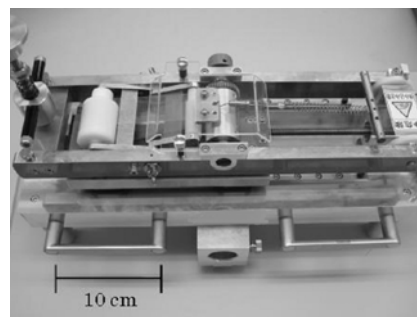
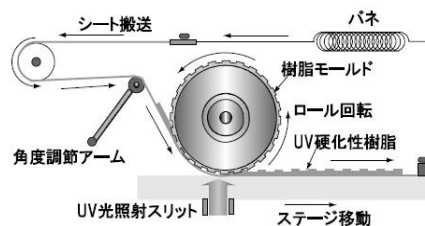


共同研究

◆早稲田大学 ナノテクノロジー研究所

水野潤 准教授

小型ロールプリント装置を用いた離型材料の特性評価



小型ロールプリント装置

NEDO助成事業 (1004) EB式次世代パターン高速検査装置

EUVマスク・次世代フォトマスク・ナノインプリント用モールドの検査は電子ビームによる検査が必須です。

マスクCD-SEMのパイオニアであるホロンが提案する電子ビーム式次世代パターン高速検査装置にご期待下さい！

自社開発